

Leitbild

Borer Chemie AG – Advanced Cleaning Technology

Wir sind auf dem Spezialgebiet der funktionalen und reinen Oberflächen ein führendes Unternehmen. Wir gehen mit innovativen Produkten, Dienstleistungen sowie mit gesamtheitlichen Lösungen auf die Bedürfnisse unserer Kunden und unserer Vertriebspartner ein.

Wir handeln umsichtig

Unsere anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung ist an vorderster Front tätig. Dabei setzen wir uns für eine nachhaltige Entwicklung und einen umsichtigen Umgang mit den Ressourcen ein.

Wir haben gemeinsame Werte

Wir sind unseren Geschäftspartnern und dem gesellschaftlichen Umfeld ein verlässlicher Partner. Unser Verhalten ist von gegenseitigem Vertrauen, persönlicher Achtung und von Fairness geprägt.

Die Mitarbeiter sind ausschlaggebend

Ausbildung sehen wir als wichtige Grundlage für die persönliche Entwicklung. Wir fördern deshalb unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und schaffen ihnen ein Umfeld, in dem sich jeder und jede Einzelne als Teil eines Teams versteht und sich persönlich entfalten kann. Zielvereinbarungen und Mitarbeitergespräche sind dazu wichtige Führungsinstrumente.

Wir übernehmen Verantwortung

Wir wollen, dass jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter unserer Firma Verantwortung für Qualität, Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz übernimmt und bei der ständigen Verbesserung mithilft.

Unser BorerManagementSystem (BMS)

Wir arbeiten mit einem zertifizierten, prozessorientierten und integrierten BorerManagementSystem, welches unsere Prozesse abbildet und die Anforderungen aus Gesetzen, Normen und Richtlinien berücksichtigt. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind dabei integrierter Bestandteil des Systems.

Wir gestalten unsere Zukunft

Wir betreiben eine leistungs- und gewinnorientierte Unternehmenspolitik, im Bestreben, die mittelfristige Weiterentwicklung der Firma zu fördern sowie die Arbeitsplätze zu sichern.

Freigabe	Erstellt/geändert		Freigabe		Inkraftsetzung	
	Datum	Name	Datum	Name	Datum	Name
	06.01.2009	R. Jordi	06.01.2009	VR	06.01.2009	M. Hochuli